

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成19年11月8日(2007.11.8)

【公開番号】特開2002-110610(P2002-110610A)

【公開日】平成14年4月12日(2002.4.12)

【出願番号】特願2000-292857(P2000-292857)

【国際特許分類】

H 01 L 21/304 (2006.01)

B 08 B 3/02 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/304 6 4 4 C

B 08 B 3/02 C

【手続補正書】

【提出日】平成19年9月26日(2007.9.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】基板の処理装置及び処理方法

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板を回転させながら処理する基板の処理装置において、上記基板の周縁部を回転駆動されるローラによって保持してこの基板を回転駆動する第1の回転駆動手段と、

この第1の回転駆動手段に保持された基板の上面を洗浄処理する上部洗浄ツールを有する上部処理手段と、

上記第1の回転保持手段に保持された基板の下面を洗浄処理する下部洗浄ツールが交換可能に設けられた下部処理手段と、

上記基板に行なう処理の種類に応じて上記下部処理手段の下部洗浄ツールを他の処理ツールに交換するツール交換手段と

を具備したことを特徴とする基板の処理装置。

【請求項2】 上記ツール交換手段によって交換される処理ツールは、上記基板を上記第1の回転駆動手段よりも高速度で回転駆動する第2の回転駆動手段であることを特徴とする請求項1記載の基板の処理装置。

【請求項3】 上記第2の回転駆動手段は、上記第1の回転駆動手段から基板を受けて保持する保持ツールと、この保持ツールを基板とともに上記第1の回転駆動手段よりも高速度で回転させる高速駆動源とを備えていることを特徴とする請求項2記載の基板の処理装置。

【請求項4】 上記下部処理手段は、先端に上記下部洗浄ツールが設けられた下部アームと、この下部アームを旋回駆動及び上下駆動する下部駆動手段とを具備し、

上記ツール交換手段は、上記下部アームを先端が上記第1の回転駆動手段に保持された基板から外れる位置に旋回させた状態で、この下部アームの先端に設けられた下部洗浄ツールを他の処理ツールに交換する構成であることを特徴とする請求項1記載の基板の処理

装置。

【請求項 5】 基板を回転させながら処理する基板の処理方法において、
請求項 1 に記載された処理装置を用いて基板を処理することを特徴とする基板の処理方
法。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0001

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は基板を回転させながら上下面を洗浄処理することができる基板の処理装置及び処理方法に関する。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0011】

この発明は、基板の上下両面を洗浄する場合に、その基板の洗浄処理と乾燥処理とを連続的に行うことができるようとした基板の処理装置及び処理方法を提供することにある。

【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0015】

請求項 4 の発明は、上記下部処理手段は、先端に上記下部洗浄ツールが設けられた下部アームと、この下部アームを旋回駆動及び上下駆動する下部駆動手段とを具備し、

上記ツール交換手段は、上記下部アームを先端が上記第 1 の回転駆動手段に保持された基板から外れる位置に旋回させた状態で、この下部アームの先端に設けられた下部洗浄ツールを他の処理ツールに交換する構成であることを特徴とする請求項 1 記載の基板の処理装置にある。

【請求項 5 の発明は、基板を回転させながら処理する基板の処理方法において、
請求項 1 に記載された処理装置を用いて基板を処理することを特徴とする基板の処理方
法にある。】